

LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY,
MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL,
PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

ceramic member and a first electrostatic electrode disposed in the first ceramic member, and which is disposed on the first upper surface; and a second electrostatic chuck which is formed separately from the first electrostatic chuck and includes a second ceramic member and a second electrostatic electrode disposed in the second ceramic member, the second electrostatic chuck being disposed on the second upper surface.

(57) 要約: 基板の冷却性を向上する基板支持台及び基板処理装置を提供する。下面と、前記下面と反対側の円形状の第1上面と、前記下面と反対側の面であって前記第1上面よりも前記下面の側に形成され、前記第1上面の周囲を囲む円環形状の第2上面を有する基台と、第1のセラミック部材と前記第1のセラミック部材内に配置される第1の静電電極とを含み、前記第1上面に配置される第1の静電チャックと、前記第1の静電チャックとは別体に形成され、第2のセラミック部材と前記第2のセラミック部材内に配置される第2の静電電極とを含み、前記第2上面に配置される第2の静電チャックと、を備える、基板支持台。